熱プラズマを用いる材料プロセッシングにおける計測技術

九州大学 大学院工学研究院 渡辺隆行

1. 緒言

プラズマを発生する方法として,直流放電,交流放 電,高周波放電が用いられてきた。これらの従来のプ ラズマ発生システムに加え,多相交流アークが新しい 熱プラズマとして期待されており,材料プロセッシン グへの応用を目的として,6相や12相などの多相交流 放電アークの研究が行われている。それぞれの電極に 位相の異なる多相交流を印加することにより,電極先 端部で囲まれた領域全体にアークを発生する方法であ る。

多相交流アークはプラズマ体積が大きく、ガス流速 が遅いという特徴があることから、粉体の高温処理に 優れており、ガラス原料のインフライトに関する研究 が重点的に行われきた。一段のプロセスで、安価でか つ大量にナノ粒子を製造することができるという長所 を有することから、多相交流アークによるナノ粒子の 合成も注目されている。今後、産業界に広く使われる ためには、プラズマ中におけるナノ粒子の生成機構の 解明と、より制御されたプロセッシングの開発が必要 である。

多相交流アークは世界的に研究例が少なく,実用化 に向けては電極の物理現象の解明が必要である。電極 現象を把握する上で,電極表面温度と電極近傍の金属 蒸気観察は重要となる。多相交流アークでは,交流20 msを1周期として時間変動するアークの強い発光のた め,従来の方法では電極の計測は困難である。2台の高 速度ビデオカメラに適切な光学系を組合せることによ り,msオーダーでの電極表面温度と電極近傍の金属蒸 気挙動の同期計測を行うことができる。ここでは電極 消耗機構の解析を目的として,熱プラズマの電極現象 の計測方法を紹介する。

2. 実験方法

多相交流アークの放電時における,電極表面温度と電 極近傍の金属蒸気挙動の同期計測を行った。両計測とも 高速度カメラとバンドパスフィルター(BPF)を用いてお り,高速度カメラの CCD 面に,異なる二波長の画像を同 時に結像させることで,温度計測と金属蒸気挙動の観察 を行うことができる。BPF の波長には,温度計測に785 nm と 880 nm,タングステン蒸気の観察に 401 nm を用いた。 これらの計測は,Fig.1 に示すように装置側面部からの電 極表面温度の計測,装置上部からの金属蒸気挙動の観察 により行った。電極材料には 2% トリア入りタングステン を用いた。電極を酸化から防ぐため、アルゴンをシール ドガスとして用い,0-10 L/min の範囲で変化させた。

3. 実験結果

Fig. 2 (a), (c)に, 12 相放電中の陽極時におけるタングス テン蒸気のスナップショット, (b), (d)に放電中電極のスナ ップショットを示す。Fig. 2 (a), (b)はシールドガス流量が



Fig. 1 Multi-phase AC arc reactor.

2 L/min, (c),(d)は5 L/min であり,それぞれが同期した画像となっている。陽極時の電流のピーク時において電極からタングステン蒸気が発生し(Fig. 2 (a)),その後は,電流値の減少とともに蒸発量が減少した。この瞬間的なタングステンの蒸発は,低シールドガス流量の条件下において顕著に観察された。低シールドガス流量の条件下では電極の酸化が促進したことに起因すると考えられる。

上述の現象について,より詳細な検討を行うためにFig. 2 (b), (d)を画像解析することにより電極表面温度分布を 算出した (Fig. 3)。低シールドガス流量の条件下おいて, 電極先端温度はより高温になることがわかった。これら の同期計測結果を解析することにより,タングステン電 極の消耗機構についての考察を行うことが可能となる。



Fig. 2 Representative snapshots of high-speed images during 12-phase discharges for anode with different Ar flow rates; (a), (b) 2 L/min; (c), (d) 5 L/min.



Fig. 3 Temperature distribution on anode during 12-phase discharge with different Ar flow rates; (a) 2 L/min, (b) 5 L/min.